2015. Том 56, № 6

Ноябрь – декабрь

C. 1230 – 1232

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 547.245:541.64

ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ТОНКИХ ПЛЕНОК SiC_xFe_y И SiC_xN_yFe_z С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ В ГЕОМЕТРИИ СКОЛЬЗЯЩЕГО ПАДЕНИЯ ПУЧКА (GIXRD)

Р.В. Пушкарёв¹, Н.И. Файнер¹, К.К. Маурия²

¹Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия E-mail: pushkarev@niic.nsc.ru ²Национальная физическая лаборатория, 110012, Нью-Дели, Индия

Статья поступила 20 августа 2015 г.

Пленки различного состава синтезированы с помощью метода химического осаждения из газовой фазы при пониженном давлении с использованием термического разложения следующих исходных газовых смесей: ферроцена $Fe(C_5H_5)_2$ и гелия; ферроцена, трис(диэтиламино)силана $[(C_2H_5)_2N]_3SiH$ (ТДЭАС) и гелия; ферроцена, 1,1,1,3,3,3-гексаметилдисилазана $[(CH_3)_3Si]_2NH$ (ГМДС) и гелия. Химический состав полученных пленок характеризовался методами ИК и КРС спектроскопии. Фазовый состав пленок изучали с помощью рентгенофазового анализа в геометрии скользящего падения рентгеновского пучка (GIXRD). Установлено, что пленки, выращенные из газовых смесей кремнийорганических соединений (ТДЭАС или ГМДС), ферроцена и гелия, имеют одинаковый химический и фазовый состав SiC_xN_yFe_z, в то время как полученные из смеси ферроцена и гелия другой — SiC_xFe_y.

DOI: 10.15372/JSC20150624

Ключевые слова: рентгеновская дифракция в геометрии скользящего падения пучка, пленки состава SiC_xFe_y и SiC_xN_yFe_z, ферроцен.

Пленки сложного состава SiC_xN_yFe_z, представляющие собой сочетание ферромагнитных свойств железа и его соединений, а также электронных свойств полупроводникового соединения карбонитрида кремния очень перспективны для создания устройств спинтроники, где спин электрона представляет собой активный элемент хранения и передачи информации [1, 2]. В дополнение к вышеуказанным свойствам этот материал имеет хорошую термическую химическую стабильность. SiC_xN_yFe_z является также экологическим материалом. В литературе имеются упоминания [3—5] о синтезе керамики SiC_xN_yFe_z, но сведения о синтезе пленок такого состава отсутствуют.

В настоящей работе описан разработанный нами синтез тонких пленок $SiC_xN_yFe_z$ и проведена характеризация их химического и фазового составов. Для сравнения были синтезированы пленки термическим разложением исходной газовой смеси ферроцена и гелия, которые также диагностировались указанными выше методами.

Эксперимент. Пленки SiC_xFe_y и SiC_xN_yFe_z выращены химическим осаждением из газовой фазы при пониженном давлении в кварцевом горизонтальном реакторе в области температур 1073—1273 К. Были изучены высокотемпературные процессы осаждения трех газообразных смесей: 1 — ферроцена и гелия; 2 — ферроцена, ГМДС и гелия; 3 — ферроцена, ТДЭАС и гелия. Гелий используется как газ-носитель. Кремниевые подложки применялись с ориентацией Si(100).

[©] Пушкарёв Р.В., Файнер Н.И., Маурия К.К., 2015

Фазовый состав полученных образцов изучали методом рентгенофазового анализа в геометрии скользящего падения рентгеновского пучка (GIXRD) с помощью высокопрецизионной системы PANalytical X'Pert PRO MRD high-resolution XRD system с длиной волны излучения $CuK\alpha_1$. Угол падения пучка фиксировали при 1° для всех измеренных образцов. В падающем пучке использовали гибридный монохроматор Ge(220).

Все ИК абсорбционные спектры пленок регистрировали с использованием спектрометра FTIR SCIMITAR FTS 2000 в области 300—4000 см⁻¹. 32 скана с апертурой, равной 4 при достигнутом разрешении 2 см⁻¹, использовались во время измерений. Для каждой серии экспериментов фоном каждому спектру служила кремниевая подложка без покрытия, прошедшая ту же предварительную предростовую химическую обработку, что и подложки Si(100) с пленками. Все подложки кремния принадлежали к одному типу (партии) материала, что гарантирует сходство фона спектров. Все спектры FTIR были нормированы на толщину пленки.

Измерения спектров рассеяния света (КРС) проводили с использованием спектрометров PHILIPS PU-95 и Triplemate, Spex. Спектры КРС регистрировали, используя длину волны аргонового ионного лазера 488 нм.

Результаты и их обсуждение. GIXRD является полезным методом для измерения дифракционных картин при малых углах падения: происходит улучшение (увеличение) сигнала от тонкой пленки и минимизируется влияние материала подложки. Дифракционная картина от пленки, выращенной из смеси 1, представлена на рисунке, *а*. Указанная на рисунке дифракционная линия относится к фазе α -FeSi₂ [6]. Предполагается, что во время высокотемпературного процесса происходит взаимодействие кремниевых атомов подложки с атомами железа, полученными во время разложения ферроцена, так как единственным источником кремния в системе является кремниевая подложка, поскольку процесс получения пленок протекает без добавления кремнийорганических соединений.

Для уточнения состава и структуры пленки SiC_xFe_y дополнительно исследовали методами ИК и КРС спектроскопии. ИК спектры содержат пики, соответствующие валентным колебаниям связей Fe—Si (480, 630, 1070 см⁻¹) [6], а острый пик при 1550—1600 см⁻¹ принадлежит валентным колебаниям связей С—C [7]. Присутствие углеродных нанотрубок в пленках SiC_xFe_y было подтверждено КРС спектроскопией.



Дифракционные картины GIXRD пленок: SiC_xFe_y, полученной из газовой смеси ферроцена и гелия (*a*); SiC_xN_yFe_z, полученной из газовой смеси ГМДС, ферроцена и гелия (δ); SiC_xN_yFe_z, полученной из газовой смеси ТДЭАС, ферроцена и гелия (ϵ). Все пленки синтезированы при температуре 1273 К

Рисунок б, в иллюстрирует дифракционные картины пленок $SiC_xN_yFe_z$, выращенных из исходных газовых смесей 2 и 3. Дифракционные линии соответствуют кристаллам, принадлежащим фазам α-Si₃N₄, β-SiC, α-FeSi₂, FeSi и графиту [8—12]. Эти результаты были подтверждены ИК и КРС спектроскопическими исследованиями. Ранее было определено, что пленки, выращенные из ТДЭАС или ГМДС, являются нанокомпозитными [13], поэтому можно предположить, что указанные выше нанокристаллы α -Si₃N₄, β -SiC, α -FeSi₂, FeSi и графит внедрены в аморфную матрицу карбонитрида кремния. Подобные результаты, в том числе образование аморфной фазы карбонитрида кремния в процессах осаждения из газовой фазы с использованием кремнийорганических соединений в качестве исходных, получены и описаны в работах [14, 15]. В частности, в работе [14] методом рентгенофазового анализа с использованием синхротронного излучения доказано образование нанокристаллов α-Si₃N₄, а методами ВРЭМ и электронной дифракции показано существование аморфной фазы в связи с наличием в изображении, полученном методом электронной дифракции, гало и системы колец. В работе [15] проведено более подробное исследование материала методами ВРЭМ и электронной дифракции локальной области. Таким образом, подтверждено образование фазы α-Si₃N₄ и наличие аморфной составляющей в пленках карбонитрида кремния двумя методами.

Размер кристаллов фазы α -FeSi₂ был оценен как 20—25 нм согласно формуле Селякова— Шеррера: $D = \lambda/\beta \times \text{Соs}\theta$, где D — размер кристалла; λ — длина волны, равная 1,5405 Å; β — уширение дифракционной линии в радианах на полувысоте пика (FWHM); θ — дифракционный угол.

Выводы. Осаждение пленок SiC_xFe_y и SiC_xN_yFe_z из газовых смесей ферроцена и гелия, ТДЭАС (или ГМДС), ферроцена и гелия изучали экспериментально с помощью химического осаждения из газовой фазы при пониженном давлении (10^{-1} — 10^{-2} Topp) в температурной области 1073—1273 К. Фазовый и химический составы пленок изучали, привлекая методы рентгеновской дифракции в геометрии скользящего падения пучка (GIXRD), ИК и КРС спектроскопии. Показано, что пленки содержат нанокристаллы, принадлежащие следующим фазам: α -Si₃N₄, SiC, α -FeSi₂, FeSi и графиту, которые, возможно, внедрены в аморфную матрицу слоев карбонитрида кремния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Jansen R., Dash S.P., Sharma S. et al. // Semicond. Sci. Technol. 2012. 27. P. 83.
- 2. Zutic I., Fabian J., Sarma S. Das // Phys. Rev. Lett. 2002. 88, N 6. P. 066603-1.
- 3. Francis A., Ionescu E., Fasel C. et al. // Inorg. Chem. 2009. 48, N 21. P. 10078.
- 4. Kong J., Kong M., Zhang X. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013. 5, N 20. P. 10367.
- 5. Ginzburg M., MacLachlan M.J., Yang S.M. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2002. 124, N 11. P. 2625.
- 6. Kolel-Veetil M.K., Keller T.M. // Materials. 2010. 3, N 2. P. 1049.
- 7. Ciabini L., Santoro M., Bini R. et al. // J. Chem. Phys. 2002. 116, N 7. P. 2928.
- 8. JCPDS International Center for Diffraction Data. 1988. USA. Card no. 35-822.
- 9. JCPDS International Center for Diffraction Data. 1988. USA. Card no. 29-1131.
- 10. JCPDS International Center for Diffraction Data. 1988. USA. Card no. 33-1160.
- 11. JCPDS International Center for Diffraction Data. 1988. USA. Card no. 26-1080.
- 12. JCPDS International Center for Diffraction Data. 1988. USA. Card no. 38-1397.
- 13. Файнер Н.И. // Журн. общ. химии. 2012. 82, № 1. С. 47.
- 14. *Файнер Н.И., Румянцев Ю.М, Косинова М.Л. //* Химия в интересах устойчивого развития. 2001. **9**. С. 865.
- 15. Fainer N.I., Kosinova M.L., Rumyantsev Yu.M. et al. // J. Phys. Chem. Solids. 2008. 69, N 2-3. P. 661.